

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年7月6日(06.07.2023)



(10) 国際公開番号

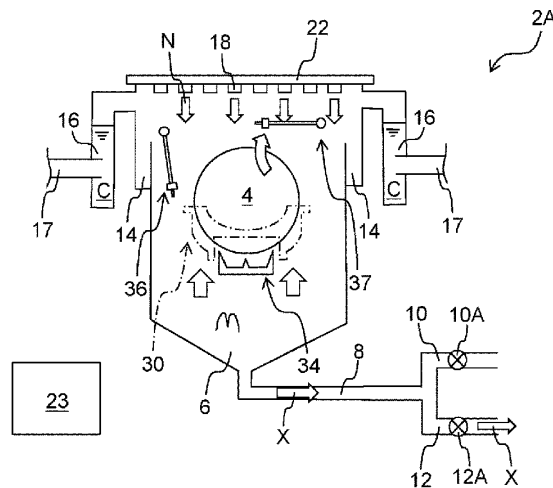
WO 2023/127393 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) *F26B 9/06* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/044367
- (22) 国際出願日: 2022年12月1日(01.12.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
PCT/JP2021/048656 2021年12月27日(27.12.2021) JP
- (71) 出願人: 東邦化成株式会社(**TOHO KASEI CO., LTD.**) [JP/JP]; 〒6391031 奈良県大和郡山市今国府町6番2号 Nara (JP).
- (72) 発明者: 出口 泰紀 (**DEGUCHI, Yasunori**); 〒6391031 奈良県大和郡山市今国府町6番
- 2号 東邦化成株式会社内 Nara (JP). 荒木 愛(**ARAKI, Ai**); 〒6391031 奈良県大和郡山市今国府町6番2号 東邦化成株式会社内 Nara (JP). 二又 善一(**FUTAMATA, Yoshikazu**); 〒6391031 奈良県大和郡山市今国府町6番2号 東邦化成株式会社内 Nara (JP).
- (74) 代理人: 山尾 憲人, 外(**YAMAO, Norihito et al.**); 〒5300017 大阪府大阪市北区角田町8番1号 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 青山特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

(54) **Title:** SUBSTRATE DRYING DEVICE, SUBSTRATE PROCESSING DEVICE, AND SUBSTRATE MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 基板乾燥装置、基板処理装置および基板の製造方法

[図60]



(57) **Abstract:** A substrate drying device (2A, 2) comprising: a drying tank (6) in which a plurality of substrates (4) are positioned, arranged at a prescribed pitch (P1); a processing fluid supply part (8, 10) that supplies a processing fluid (W) to the drying tank (6); an organic solvent supply part (16, 17) that supplies an organic solvent (CV) to the drying tank (6); and an inert gas supply part (18) that supplies an inert gas (N) to the drying tank (6), wherein the drying tank (6) is provided with a substrate support part (34) that supports the plurality of substrates (4), and an interval ensuring member (36, 37) that is driven so as to approach an end section (41, 42, 44) of the plurality of substrates (4) supported by the substrate support part (34) and ensure an interval between the substrates (4).

[続葉有]

WO 2023/127393 A1

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,
KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約: 基板乾燥装置(2A、2)は、複数の基板(4)を所定ピッチ(P1)で配列した状態で配置する乾燥槽(6)と、乾燥槽(6)へ処理液(W)を供給する処理液供給部(8、10)と、乾燥槽(6)へ有機溶剤(CV)を供給する有機溶剤供給部(16、17)と、乾燥槽(6)へ不活性ガス(N)を供給する不活性ガス供給部(18)と、を備え、乾燥槽(6)には、複数の基板(4)を支持する基板支持部(34)と、基板支持部(34)で支持された複数の基板(4)の端部(41、42、44)に近接して基板(4)同士の間隔を確保するように駆動される間隔確保部材(36、37)とが設けられる。